電圧誘起巨大トンネル磁気キャパシタンス効果の観測と理論的解明

緒方健太郎*、中山雄介*、Gang Xiao**、海住英生****、 (*慶大理工、**ブラウン大理、***慶大スピンセンター)

Observation and theoretical calculation of voltage-induced large tunnel magnetocapacitance effect K. Ogata*, Y. Nakayama*, G. Xiao** and H. Kaiju*.***

(*Keio Univ., **Brown Univ., ***Keio Univ. CSRN)

はじめに

近年、磁気トンネル接合(MTJ)におけるトンネル磁気キャパシタンス(TMC)効果は、トンネル磁気抵抗 (TMR)効果には見られないいくつかの新現象を示す他、高感度磁気センサや磁気メモリへの応用も期待され ていることから、国内外で注目を集めている[1,2]。TMC 効果の興味深い特徴の一つとして、電圧に対するロバスト性が挙げられる。例えば、TMC の $V_{1/2}$ (=ゼロバイアス付近の TMC 比が半分になるときの電圧)は TMR と比較して 2 倍程度大きいことが報告されている[3]。このようなロバスト性に関連して、本研究では、室温にて 300%を超える巨大な電圧誘起 TMC 効果の観測、及びその理論計算フィッティングに成功したので、詳細について報告する。

実験方法

超高真空マグネトロンスパッタ装置を用いて、熱酸化 Si 基板上に $Ta/Co_{50}Fe_{50}/IrMn/Co_{50}Fe_{50}/Ru/Co_{40}Fe_{40}B_{20}/MgO/Co_{40}Fe_{40}B_{20}/Ta/Ru$ から構成される MTJ を作製した。強磁性層 $Co_{40}Fe_{40}B_{20}$ の膜厚は 3 nm、絶縁層 MgO の膜厚は 2 nm とした。微細加工にはフォトリソグラフィーとイオンミリング法を用いた。接合面積は $1800~\mu m^2$ とした。 TMC および TMR 効果の測定には、室温磁場中交流 4 端子法を用いた。

実験結果

図1に電圧印加時の TMC 効果を示す。周波数 160 Hz、印加電圧 92 mV の条件下で 300%を超える TMC 比が観測された。図2に周波数 30、160、400 Hz における TMC 比のバイアス電圧依存性を示す。TMC 比はある特定の電圧範囲内で増加し、最大値を示した。また、TMC 比の電圧依存性は周波数 160Hz で最も大きな挙動を示すこともわかる。これらの実験結果は、放物線バリア近似、スピン依存ドリフト拡散モデル、Debye-Fröhlich モデル[4]に加えて、シグモイド関数を取り入れた Zhang モデル[5]による計算結果と良い一致を示した。これは Zhang モデルにおけるスピンフリップが巨大な電圧誘起 TMC 効果に大きな影響を及ぼすことを意味する。講演ではより詳細な実験・計算結果について報告する。

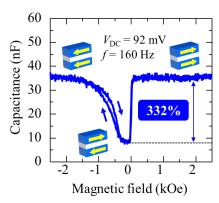


図 1: 電圧印加時の TMC 効果

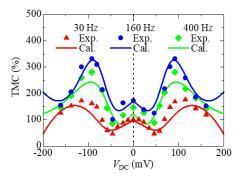


図 2: 各周波数における TMC 比の バイアス電圧依存性

参考文献

- [1] H. Kaiju et al.: Appl. Phys. Lett. 107, 132405 (2015).
- [2] T.-H. Lee et al.: Sci. Rep. 5, 13704 (2015).
- [3] A. M. Sahadevan et al.: Appl. Phys. Lett. 101, 162404 (2012).
- [4] H. Kaiju et al.: Sci. Rep. 7, 2682 (2017).
- [5] S. Zhang et al.: Phys. Rev. Lett. 79, 3744 (1997).